

다이아몬드 수돌의 高能率

Dressing 에 관한 研究

최 광 일*, 강 재 훈**, 정 윤 교***

A Study on High Efficiency Dressing of Diamond Grinding Wheel

Kyoung-ill Choi*, Jae-hoon Kang**, Yoon-gyo Jung***

Abstract

A diamond grinding wheel is generally used to grind hard and brittle materials, such as advanced ceramics. It is, however, quite difficult to dress a diamond grinding wheel efficiently because of its high degree of hardness. In this study, some investigations are carried out to increase dressing efficiency of resinoid bonded diamond grinding wheel. Dressing forces are measured over a wide range of dressing conditions, and SEM observation of a grinding wheel is carried out. Special attention is paid to comparison between stick method and rotary brake method. Results obtained in this study provide useful information determining required dressing time, and for choosing efficient dressing condition for diamond grinding wheel.

key word : Grinding, Dressing, Resinoid Bonded Diamond Wheel, Dressing Force, Specific Grinding Power, Wheel Life

* : 창원대학교 기계공학과 대학원

** : 한국 기계연구소(정회원)

*** : 창원 대학교 기계공학과 조교수(정회원)

Nomenclature

F_{nd}	: Normal Dressing force
F_{td}	: Tangential Dressing force
f_{nd}	: Specific normal dressing force
f_{td}	: Specific tangential dressing force
h	: Grinding depth of cut
h_d	: Dressing depth of cut
M_d	: Specific dresser removal
p	: Grinding power
p_g	: Grain load
p_f	: Limit Grinding power
T	: Dressing time
T_d	: Wheel life
T_g	: Grinding time
V_d	: Wheel velocity during dressing
V_g	: Wheel velocity during grinding
α	: Dressing efficiency
β	: Dressing ratio

1. 緒論

파인 세라믹의 機械加工法으로서 Diamond 숫돌에 의한 研削加工이一般的으로 使用되어 지고 있다⁽¹⁻²⁾. 그러나, 파인세라믹과 같은 難削材의 研削加工에는 Diamond 粒子의 Glazing 現象이 急激히 進行하기 때문에, Dressing에 의해 粒子先端의 Sharpness를 回復시킬 必要가 있다. 오늘날, Diamond와 같은 超粒子의 Dressing 方법으로는 GC 및 WA Stick 숫돌의 使用이 가장 一般化되어 있다⁽³⁾.

純度가 높은 炭化硅素(GC)의 Stick Dresser를 手作業으로 숫돌면에 눌러 대면서 Dressing을 하는 방법은, Stick만 있으면 研削盤의 機種에 關係없이 實施할 수 있는 簡便함이 있어 現在 幅넓게 使用되어지고 있으나, 手作業이기 때문에 安全管理上의 問

題도 있고 Truing후의 숫돌의 形상, 精度를 破壞함이 없이 Dressing을 遂行하는 것은 매우 困難하며, 作業者에 따라 一貫性이 없고 再現性의 缺乏등의 缺點을 内包하고 있다. 이것은 파인세라믹의 高能率研削에 큰 問題點으로 되어있다⁽⁴⁾.

本研究에서는, 파인세라믹의 高能率研削을 確立할 時의 하나의 問題點인 Diamond 숫돌의 Dressing에 注目해서, 能率的인 同時に 安定한 研削結果가 얻어 질수 있는 Dressing 條件의 實驗적 選定을 試圖했다. 이를 위해 GC Stick 숫돌을 Dresser로서 使用한 Resinoid Bonded Diamond 숫돌의 Dressing에 있어서, Dressing 抵抗을 監視함에 의한 必要最少 Dressing 時間의 決定, 各種 Dressing 條件下에서의 Dressing 效果의 檢討도 遂行했다.

2. Resinoid bonded Diamond 숫돌의 特징

Diamond 숫돌은 Bond의 종류에 따라서 Resinoid, Metal, Vitrified, 電着등 크게 4가지로 大別된다. 그 중 Resinoid Bond는 热硬化性의 페놀樹脂가 主流로, 耐熱性의 포리이미드樹脂도 많이 使用되어지고 있다⁽⁵⁾.

Resinoid Bond의 주류인 페놀系樹脂는 다른 結合劑에 比較해, 彈性係數가 작기 때문에 Soft한 使用感으로 衝擊이 緩和된다는 特徵이 있다. 그 반면 切入에 대해 粒子切刃이 後進하여, 高精度의 가공이 不可能하다는 缺點을 가진다. 더구나 이 Bond는 热劣化性이기 때문에 研削發熱에 의해 局部의 Bond의 热劣化가 발생해, 粒子의 保持力이 低下한다. 숫돌의 製造面에 있어서는, 그 製造溫度가 200 °C 以下이기 때문에 温度安定性이 낮은 Diamond 粒子의 热的影響은 문제가 되지 않음과同時に 충전제, 보강제등을 필요에 따라서 이용가능해져, Bond의 改質 및 補強이 간단하다는 利點이 있다.

Resinoid Bond는 Metal Bond와 같이 Diamond 粒子와 親和力이 없기 때문에 粒子保持力を 높일手段으로, 숫돌은 無氣孔 Type, 즉, Bond Matrix

Type으로 하는것이一般的이다. 그 때문에 숫들의自生發刃作用은期待할 수 없고研削에 의해 절삭능률이 떨어진 숫들을 Dressing에 의해 Chip Pocket을 형성시킬必要가 있다. Chip Pocket 형성과정을 fig. 1에 표시한다. 그러나 숫들결합체의 종류에 의해

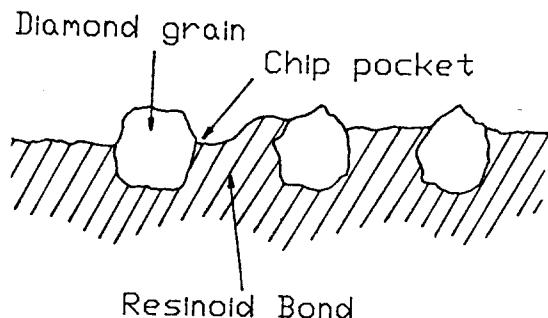


Fig.1 Configuration of chip pocket

Dressing 方法도難易度도 다르다. 예를들면, Bond 자체의 強度가 높고 岡性이 있는 Metal Bond 숫들의 Dressing은 通常의 Stick 法으로는 Dressing이 困難하고 특수한 방법을 사용하는 것이一般的이다. 그에 比較해, Resinoid Bond는 比較的 強度가 작기 때문에, GC 및 WA 숫들로 容易하게 Dressing이 可能하다. 이것이 세라믹의 研削에 있어서 Resinoid Bonded Diamond 숫들이一般的으로 사용되어지고 있는 큰 現由중의 하나이다.

3. 實驗裝置 및 實驗方法

本 實驗에 使用한 平面研削盤은, 主軸動力 3.75kW를 가진다. 法線力 F_{nd} 및 接線力 F_{ta} 는 KISTLER 社製 9257 A형 力計로, 研削動力 P 는 VALENITE社 720-002/305 Power Monitor로 測定했다. 이들의 構成을 fig. 2에 표시한다. 또 fig. 2에서 보는바와 같이 숫들의一部分을 除去 및 裝着할 수 있는 숫들 ($150 * 25 * 25\text{mm}$)을 製作해, Dressing 後의 숫들의 狀態를 觀察했다. 實驗에 使用된 Dresser는 直方體形상 ($150 * 25 * 25\text{mm}$)을 한

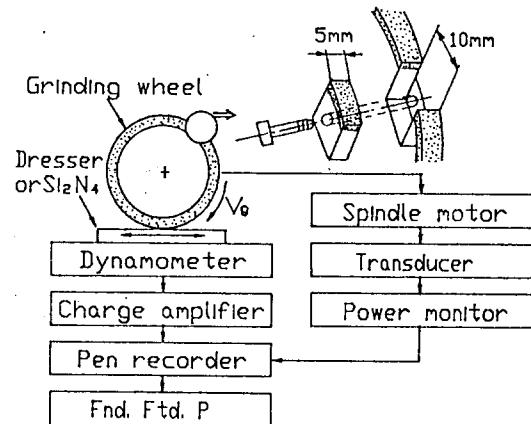


Fig.2 Dressing with abrasive- stick and- Wheel

C220G8V와 圓筒形상 (直徑 50mm, 幅 25mm)을 한 C150M8V의 2種類를 選定했다. Dressing 方法은 fig. 3의 左側에 表示한 것처럼, 直方體形狀의

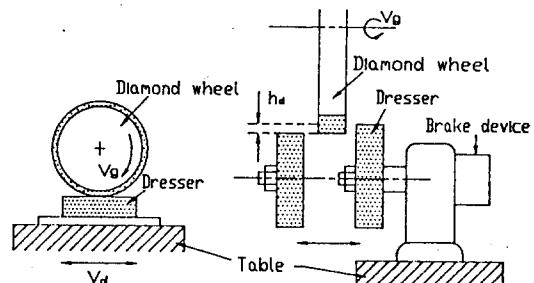


Fig.3 Experimental setup

Dresser를 Vise에 裝着해서 Dressing을 행하는 法(Stick法)과, 그림3의 右側에 表시한 것처럼, 圓筒形상의 Dresser를 Rotary Brake 裝置에 裝着해서 Dressing을 행하는 法(Rotary Brake 法)을 취했다. 또 研削液은 Solution Type 研削液을 40倍稀釋해서 研削 및 Dressing 時에 使用하고, 工作物은 窒化硅素를 使用했다.

4. Dressing 効果의 評價方法

Fig. 4는 Dressing 후에 窒化硅素를 繼續研削한

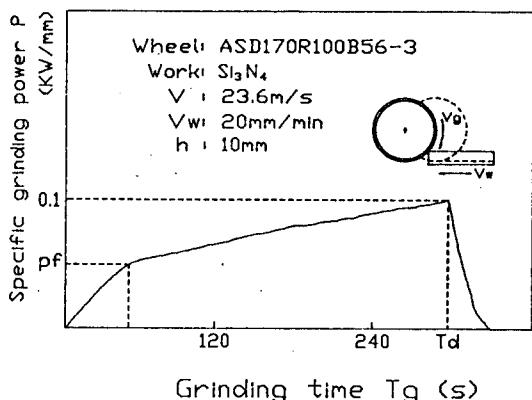


Fig. 4 Increase in grinding power during creep-feed grinding

경우, 研削動力의 測定例를 나타낸다. 研削條件으로서는, Glazing 現象이 極甚한 Creep-feed 研削(工作物速度 $V_w=20 \text{ mm/min}$, 研削깊이 $h=1 \text{ mm}$)을採用了⁽⁶⁻⁷⁾. Fig. 4에서 알 수 있는 것처럼, 最初에 矫子과 工作物과의 接觸길이가 一定하게 될때까지 研削動力이 急激히 增加하고, 接觸길이가 一定하게 된 후에도, 粒子의 Glazing 現象에 의해 研削動力은 漸次로 增加하여 간다. 比研削動力(矟子單位幅當의 研削動力)이 本研究에서 設定한 許容界限比研削動力 0.1 kW/mm 에 到達했을 때를 矫子의壽命에 到達했다고 判斷한 후, 研削을 終了했다. 各種 Dressing 條件下에서의 Dressing 効果를 調査할 時의 研削條件은 모두 fig. 4의 Creep-feed 研削條件으로統一했다. 여기에서 矫子과 工作物과의 接觸길이가 一定하게 되는 時點의 研削動力 P_f , 研削動力이 許容界限研削動力에 到達할 때 까지의 研削時間 T_d (矟子의壽命)를 Dressing 効果를 評價하는 尺度로 사용했다.

5. 必要最小 Dressing 時間의 決定

現在, Diamond 矫子를 Dressing 할 時의 가장 큰 問題點의 하나는, 어느 時點에서 Dressing을 終了시킬까 하는 判斷基準이다. 必要以上의

Dressing은 Dresser, 矫子 및 時間의 消費를 增大시킬 뿐이다.

Fig. 5는 Dressing 時間 T 의 經過에 따라서 比法

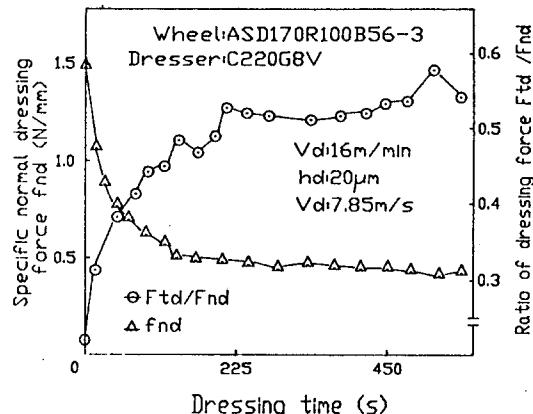


Fig. 5 Dressing force and dressing force ratio

線 Dressing 抵抗과 Dressing 抵抗의 分力比 F_{td}/F_{nd} 의 變化를 同時に 표시한 것이다. 그림에서 알 수 있는 바와 같이, 研削直後는 Diamond 先端의 鈍化에 起因해서, 法線 Dressing 抵抗의 値이 크게 나타나지만, Dressing이 進行함에 따라서 法線 Dressing 抵抗은 急激히 減少한다. Fig. 5의 Dressing 條件으로는 Dressing 時間이 約 200sec附近을 境界로 그 變化가 緩慢하게 되어간다. Dressing 抵抗의 分力比도 法線 Dressing 抵抗과 같은 推移를 나타내고 있다. 이러한 現象들은, Dressing에 의해 Diamond 矫子의 Sharpness가 漸次的으로 回復하여 가는 過程에 對應하고 있다고 생각되어 진다.

다음에 必要最小 Dressing 時間을 決定하기 위해, 各 Dressing 時間마다 Dressing 効果를 比較했다. Fig. 6는 Dressing 時間에 대해서 單位 Dresser 消費體積當의 研削動力의 減少率(여기에서는 Dressing 効率 α 로 名稱한다)과, 單位 Dresser 消費體積當의 矫子壽命間研削量(여기에서는 Dressing 比 β 로 名稱한다)의 推移를 나타낸 것이다. Fig. 6에 있어서의 Dressing 條件은 fig. 5와

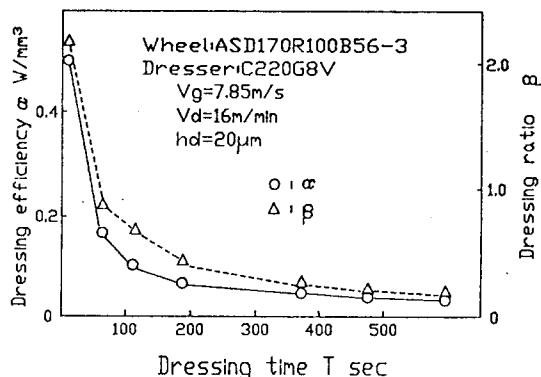


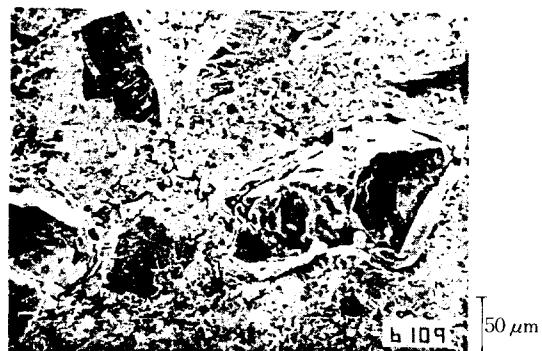
Fig. 6 Dressing efficiency and dressing ratio

같도록 設定했다. Fig. 6으로부터, Dressing 效率, Dressing 比 어느것도 Dressing 時間이 200sec 附近까지는 急激히 減少하여 간다. 얻어진 Dressing 效率에 대한 Dresser의 消耗, Dressing 時間의 消費 및 치들의 消耗를 考慮했을 경우, 必要最小 Dressing 時間은, 法線 Dressing 抵抗 혹은 Dressing 抵抗의 分力比의 急激한 變化가 安定되는 時點으로 하는 것이 合理的이라고 말할 수 있다. 이러한 必要最小 Dressing 時間을 決定하기 위해서, Dressing 中의 抵抗을 監視하는 System이 必要하게 된다.

研削直後와 Dressing 後에서의 粒子의 狀態를 電子顯微鏡으로 관찰한 結果를 fig. 7의 (a), (b) 및 (c)에 표시한다. 研削直後 치들의 先端은 磨滅에 의한 平坦한 면이 많이 관찰되어 있는데 비해, Dressing 時間이 200초 부근에서의 치들의 表面상태는 研削直後에 비교해 결합체가 깊게 除去되어 Chip Pocket이 잘 형성되어져 있음을 알 수 있다. 그러나 fig. 7 (c)에서 보는 바와 같이 과도하게 Dressing 시간을 길게해도 粒子의 表面상태에 큰 변화는 보이지 않는다.

6. Dressing 條件의 影響

Resinoid Bonded Diamond 치들의 工作物에 대한 除去能率은, 粒子先端의 Sharpness와 結合劑



(a) Affer grinding
Work : Si_3N_4 $V_w = 20mm/min$
 $V_g = 23.6m/s$ $h = 1mm$



(b) Affer dressing
Dresser : C220G8 $V_d = 16m/min$
 $V_g = 7.85m/s$ $h_d = 20 \mu m$
 $T = 200sec$



(c) Affer dressing
Dresser : C220G8 $V_d = 16m/min$
 $V_g = 7.85m/s$ $h_d = 20 \mu m$
 $T = 650sec$

Fig. 7 Micrographs of grain cutting edges

面으로부터의 粒子의 突出量에 左右되어 진다는 思考에 立脚하면, 바람직한 Dressing 條件은 粒子先端形상의 修正과 粒子의 突出量의 創成이 同時에, 또 能率的으로 遂行되어 질 수 있는 條件이라고 말할 수 있다.

Fig. 8은 各種의 Dresser 速度 V_d 와 Dressing 깊이 h_d 의 組合에 있어서, Dressing 時間의 經過에 따른 Dressing 抵抗의 分力比의 推移를 나타낸 것이다. Fig. 8로부터, Dresser 速度와 Dressing 깊이가 큰쪽이 Dressing 抵抗의 分力比가 安定하는 時點이 빨리 나타남을 알 수 있다. 즉 必要最小

Dressing 時間이 短縮되어져 있다. 이것은 Dresser 速度와 Dressing 깊이의 增大에 의해 숫돌粒子와 Dresser의 干涉面積이 크게 되기 때문에, Dressing 時에 Diamond 粒子에 걸리는 負荷 P_g (粒子負荷) 가 增大함과 同時에, 숫돌의 結合劑가 깊게 除去되어지기 때문이라 생각되어진다.

以上의 事項을 綜合的으로 檢討하기 위해, Dressing 抵抗의 測定結果로부터, 1개의 Diamond 粒子에 걸리는 負荷 P_g 를 計算해, 比研削動力과 숫돌壽命에 대하여 整理한 것이 fig. 9과 fig. 10이다. 여기에서, 單位 숫돌 幅當의 Dressing 量 M_d 는 같

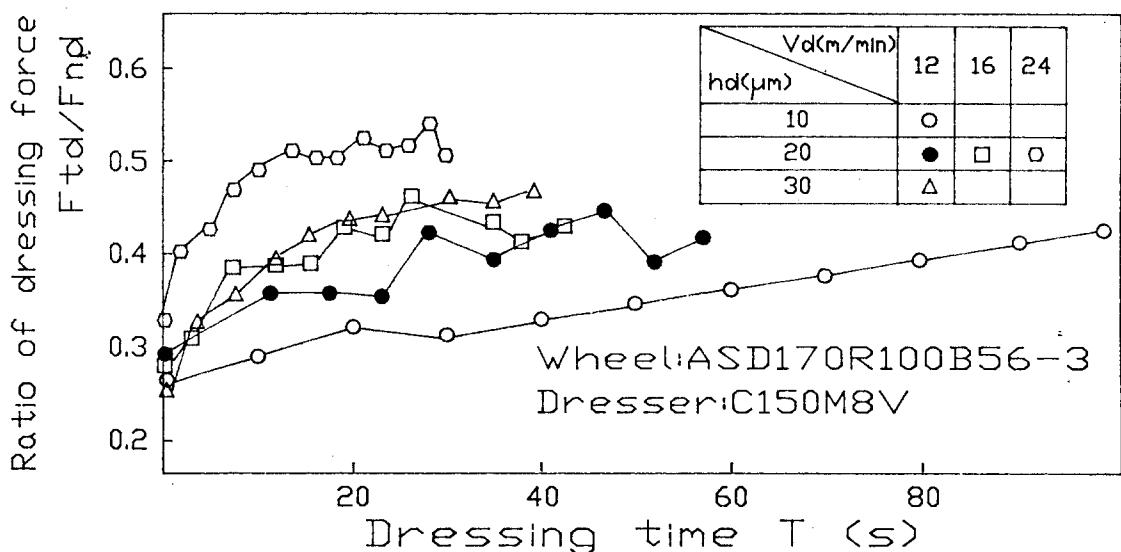


Fig. 8 Influence of dressing condition on dressing force

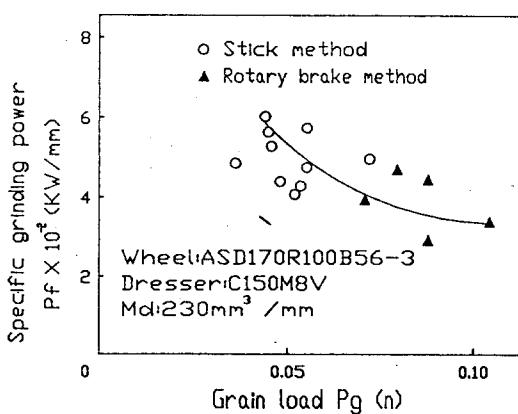


Fig. 9 Influence of dressing condition on specific grinding power

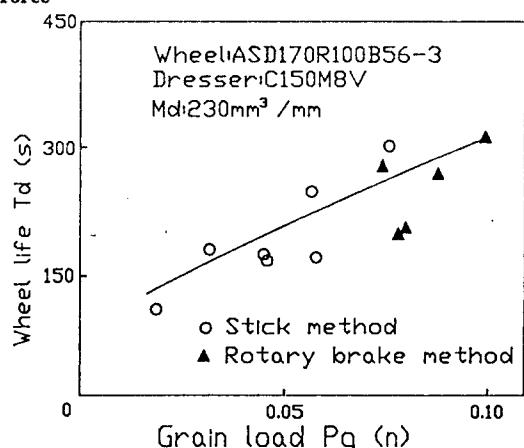


Fig. 10 Influence of dressing condition on wheel life

은 條件으로 一定하게 設定되어져 있다. 粒子負荷는, Dressing 抵抗의 合力を Dresser와 칫돌의 接觸表面上에 存在하는 Diamond 粒子의 數로 나눈 값이다. 또 그림 中에는, Stick 法과 Rotary Brake 法의 兩者가 同時に 表示되어져 있다. 粒子負荷가 增大함에 따라서 比研削動力은 減少하고, 칫돌壽命은 增大하며, Diamond 칫돌의 Sharpness가 向上됨을 알수 있다. 따라서 Dressing 時間의 短縮, 研削能率의 向上을 指向할 경우, 粒子負荷를 크게 하는 Dressing 條件이 바람직하다고 結論되어진다. 단 연삭 表面粗度 등 表面品質의 관점에 대해서는 別途의 검토가 필요하다.

여기에서, 較味 있는 事項은, 粒子負荷를 整理하면, Dressing 効果가 Stick 法의 경우도, Rotary Brake 法의 경우도 一義的으로 解析되어지는 點이다. 칫돌과 Dresser의 幾何學的 接觸狀態가 完全히 相異됨에도 불구하고 fig. 9과 fig. 10에서 보는 바와 같이, Dressing의 効果가 統一的으로 解析되어 진다는 것은, Dressing 中의 粒子負荷가 Dressing 効果를 評價하는 因子로서 有用하다는 證明이 된다. 幾何學的인 接觸狀態⁽⁸⁾로부터 알수 있는 것처럼, Rotary Brake 法의 粒子負荷가 一般的으로 크게 된다.

Fig. 11은 Dresser 칫돌의 材質을 變化시켰을 경우, Dressing 時間에 대한 Dressing 抵抗의 分力比의 推移를 나타낸다. C220G8V, C150M8V 어느 것의 경우도 그림 8과 같은 傾向을 표시하고 있지만 結合度가 높은 C150M8V Dresser를 使用한 경우에 必要最小 Dressing 時間이 短縮되어져 있다. 結合力이 큰 Dresser쪽이 Diamond 칫돌의 Dressing에는 効果의이라 생각되어진다.

7. 結論

本研究에서는 Resinoid Bonded Diamond 칫돌의 Dressing의 高能率化를 目的으로 一連의 實驗을 遂行했다. 그 結果, Diamond 칫돌의 Dressing을 어느 時點에서 終了시킬까, 또, Dressing 條件을

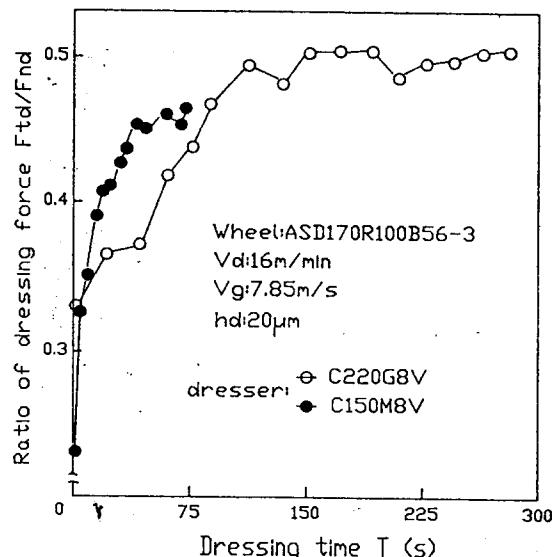


Fig. 11 Influence of abrasive dresser stick on dressing force ratio

어떠한 指針에 따라서 決定하면 좋을까등, 基本的事項에 관해서 有用한 知識을 얻을 수 있었다. 以下 얻어진 結論을 要約한다.

- (1) Dressing 抵抗의 監視結果로 부터, 必要最小 Dressing 時間은 Dressing 抵抗 및 Dressing 抵抗의 分力比가 安定하는 時點으로 하는 것이 合理의이다.
- (2) Dressing 中의 粒子負荷가 크게 되는 條件設定이 能率의인 Dressing을 遂行하는데 有利하다는 것이 明確하게 되었다.
- (3) Stick Dressing 法과 Rotary Brake Dressing 法 어느 方式에 있어서도 粒子負荷의 大小에 의해 Dressing 効果는 一義的으로 決定된다.

参考文獻

- (1) 烏葉智眞, “セラミックス 加工技術の現状”, 機械技術, 32-2, pp. 51(1984)
- (2) E. Salje, H-H. Damlos and H. Hohler,

"Internal Grinding of High Strength Ceramic Workpiece Materials with Diamond Grinding Wheel", Annals of the CIRP, Vol. 34-1, pp. 253(1985)

(3) 小林, 西岡, "超砥粒砥石のツルーアイングとドレツツング"

機械と工具, pp. 33(1987)

(4) 鄭潤教, 稲崎一郎, 松井敏, ファインセラミックスの高能率研削に関する基礎研究", 日本機械學會論文集C編, 53-485, pp. 209(1987)

(5) 橫川, "CBN ホイルベ 研削加工技術", 工業調査會, pp. 28(1988)

(6) Y. Furukawa, S. Ohishi and shiosaki, "Difference of grinding Mechanism Between Up and Down Cut Creep-feed Grinding", Bull. of Japan Soc. Prec. Engrs., Vol. 14, pp. 85(1980)

(7) 鄭潤教, 稲崎一郎, 松井敏, "ファインセラミックスのクリープフィード 研削" 日本機械學會論文集 C編, 53-491, pp. 1571(1987)

(8) 白井+, "切削加工學下", 共立出版株式會社, pp. 26(1987)

용어해설

LAN (근거리情報공유체계)

여러대의 컴퓨터와 주변장치가 전용의 통신회선을 통해 연결되어 있는 통신 네트워크.

비교적 가까운 지역이나 영역에 한정되는 개념으로 한사무실이나 건물, 인근 지역 관계사 사이 등의 전산망구축 개념이다.

정보가 중요한 무형의 자산개념으로 자리잡으면서 기업을 선두로 한 LAN 구축이 최근들어 봄을 이루고 있다.

종래 LAN의 최대 범위는 수백m에서 수km이내였으나 점차 범위가 넓어지고 있다. 즉 업무상 하나의 단위로 분류할 수 있는 기업간 전산망 구축도 광의의 LAN으로 분류되기도 한다. 이는 대기업들의 LAN 구축이 다소 먼 거리에 있는 계열사까지 포함하는데 따른 것이다.

이에 대비되는 WAN 전체나 대륙간 연결 네트워크이다.

LAN의 기능은 컴퓨터간의 파일전송, 전자우편 또는 여러 대의 컴퓨터가 하드 디스크나 프린터의 지원을 공유하는 것 등이다.